

設計製造等の機器使用基本利用料金表（2025年4月1日～）

設置場所	用途	装置番号と装置名		仕様	型番	メーカー	利用料金
(1F) プロセス室	イオン注入	1	イオン注入装置	リンおよびホウ素のイオン注入	IMX-3500	ULVAC	6,000円／時間
	成膜	2	減圧CVD装置	poly-Si堆積	272-M200	光洋リンドバーグ	4,000円／時間
		3	PE-CVD装置	SiO ₂ , SiN, a-Siの堆積	PD-200NL	サムコ	6,000円／時間
		5	スパッタ装置2	各種金属膜の堆積 2inchターゲット φ4inch以下の基板対応	E-200S	キャノンアネルバ	4,000円／時間
	酸化 拡散 熱処理	7	電気炉1号炉	ドライ酸化用 Siウエーハのみ	M200, M300	光洋リンドバーグ	4,000円／時間
		8	電気炉2号炉	ドライおよびウェット酸化用 Siウエーハのみ	M200, M300	光洋リンドバーグ	4,000円／時間
		9	電気炉3号炉	シンタリング用 金属はAl限定	M200, M300	光洋リンドバーグ	4,000円／時間
		10	電気炉4号炉	拡散用 Siウエーハのみ	M200, M300	光洋リンドバーグ	4,000円／時間
		11	電気炉5号炉	材料限定無し	M200, M300	光洋リンドバーグ	4,000円／時間
		12	縦型拡散炉	ゲート酸化膜作製用	V4-25LL	ULVAC	4,000円／時間
		13	高速熱処理炉1	極薄酸化膜形成用 φ4inch基板対応	RTP-6	ULVAC	4,000円／時間
	エッチング	15	Si系材料 ドライエッチング装置	Si, SiO ₂ , SiNのエッチング	RIE-101iPH (フッ素ガス仕様)	サムコ	6,000円／時間
		16	Metal系材料 ドライエッチング装置	上記以外材料のエッチング	RIE-101iPH (塩素ガス仕様)	サムコ	6,000円／時間
(1) フォト室	描画	18	電子線描画装置	4inchおよび5inch角フォトマスク, φ4inchSiウエーハ対応	JBX-6300	JEOL	4,000円／時間
	露光	19	縮小投影露光装置	i線露光 φ4inchSiウエーハおよび 35mm角基板対応	FPA-3000i5+	キャノン	8,000円／時間
		20	両面マスクアライナー	g線露光 4inchおよび5inch角フォトマスク, φ4inch以下試料対応	MA-6	ズースマイクロテック	4,000円／時間
(1F) プロセス室	薬品洗浄 エッチング	22	無機ドラフトチャンバー(HF)	HF, BHF洗浄	HSS-2000HF	ダン産業	2,500円／時間
		23	無機ドラフトチャンバー(一般酸)	HF, BHF以外の洗浄およびエッチング	HSS-2000HF	ダン産業	2,500円／時間
		24	RCA洗浄槽	RCA洗浄(Siのみ) ピラニア洗浄(Si, フォトマスクのみ)		ダルトン	2,500円／時間
	レジスト除去	25	アッシャー1	レジスト除去	RP-510	ヤマト科学	2,500円／時間
	ウエハ乾燥	26	スピンドライヤー	Siウエーハの乾燥 φ4inchウエーハカセット専用	SPD160RN	コクサン	2,500円／時間
	レジスト塗布	28	スピンコーター1	i線レジスト塗布 EBレジスト塗布	DELTA80	ズースマイクロテック	2,500円／時間
		29	スピンコーター2	TSMR, OMR塗布	MS-B150	ミカサ	2,500円／時間

(1F) フォト室	ベーク	30	クリーンオープン	EBレジスト乾燥	DE410	ヤマト科学	2,500円／時間
		31	ホットプレート1	フォトレジスト乾燥	TH-900	アズワン	1,000円／時間
		32	ホットプレート2	フォトレジスト乾燥	TH-900	アズワン	1,000円／時間
	現像	33	有機ドラフトチャンバー1	現像, 有機薬剤による洗浄	HSS-2000	UNION	2,500円／時間
(1F) プロセス室	観察 寸法測定	34	DUV顕微鏡	ウェーハ上, マスク上パターンの確認 5ミクロン以下のパターン観察	INM300 DUV	KLA-Tencor	2,500円／時間
(1F) 材料作製 室	観察 寸法測定	35	光学顕微鏡2	測長顕微鏡 ウェーハ上, マスク上パターンの確認 5ミクロン以上のパターン観察	エクリプスL200AF	NIKON	2,500円／時間
	成膜	38	蒸着装置1	金属膜堆積	E-250	島津製作所	2,500円／時間
	レジスト塗布	41	スピニングコート3	フォトレジスト塗布 (6インチφまで対応)	MS-B150	ミカサ	2,500円／時間
(2F) マイクロ化 技術室	薬品実験	49	有機ドラフトチャンバー	有機薬品専用			2,500円／時間
		50	無機ドラフトチャンバー	無機薬品専用			2,500円／時間
	チップの接合	52	接合装置	陽極接合、加熱加圧接合	KOG-404-V改	PMT	2,500円／時間
	ガラス機械加 工	53	ガラス加工装置	ガラス, Siなど脆性材料の機械加工	DBM-100-S1	PMT	2,500円／時間
	切断	54	ダイサー+マウンター	ウェーハダイシング	DAD322	DISCO	2,500円／時間
	表面・断面観察	55	簡易SEM	表面・断面観察 φ6inchまで対応可能	JCM-5700	日本電子	2,500円／時間
		56	実体顕微鏡1	表面観察	SMZ1000	ニコン	1,000円／時間
(2F) 状態評価 室	表面・断面観 察	57	FIB/SEM複合装置	加工, 表面・断面観察	JIB-4600F	JEOL	4,000円／時間
	表面観察	59	SCM/SPM装置	表面形状観察	MultiModeVS SPM System	日本ビーコ	2,500円／時間
(2F) システム化 技術室	ワイヤー ボンダー	60	WEST-BOND	ワイヤーボンディング	7476D	ハイソル	2,500円／時間
(2F) 設計開発 室		62	ブローピングシステム	MOSTランジスター特性評価		アジェントテクノロジー +ベクターセミコン	2,500円／時間
(2F) マイクロ化 技術室		63	高電圧カーブトレーサ +ブローパー	高耐圧デバイス特性評価	CS-3300	岩通 +ベクターセミコン	2,500円／時間
(1F)炉体 室	抵抗測定	64	四探針測定器1	抵抗値測定, TCR測定	Model RT-70 RG -5 +TCR	ナプソン	1,000円／時間
	接合強度測定	65	ダイシエATEST装置	接合強度の評価	4000P	デイジ	1,000円／時間
(2F)状態 評価室	段差測定	69	表面形状測定器2	段差測定	DEKTAK3	SLOAN	1,000円／時間
	成膜	73	厚膜CVD	TEOSによるSiO2の堆積	PD-100ST	サムコ	4,000円／時間

1F) プロセス室	エッチング	74	ALD装置	Al2O3膜の堆積	Savannah S100-4PVP	ケンブリッジ	4,000円/時間
		75	高速深堀RIE	Siの深堀り	800iPB	サムコ	6,000円/時間
		76	XeF2エッチャー	Siの等方性ドライエッチング	自作	自作	4,000円/時間
(2F) マイクロ化 技術室	洗浄	77	超臨界乾燥洗浄装置	構造倒伏防止乾燥	LSCRD403	隆祥産業	2,500円/時間
	研磨	78	断面研磨システム	断面観察用研磨、チップ研磨	MPC2000	ビュラー	2,500円/時間
	メッキ	79	メッキ装置	金、銅メッキ(電解、無電解メッキ対応)		北斗電工	2,500円/時間
	塗布	80	クイックコーター	SEM観察前処理用	SC-701MK II	サンヨー電子	2,500円/時間
	熱処理	82	小型チューブ炉	有機膜熱処理用	KTF050N1	KOYO	2,500円/時間
	信頼性評価	83	オープン	乾燥、恒温測定	DX302	Yamato	1,000円/時間
	観察	84	光学顕微鏡	表面観察	ECLIPSE	NIKON	1,000円/時間
(2F) 設計開発 室	特性評価	86	半導体パラメータアナライザ3 +ブローパー	MOSTランジスター特性評価	B1500A	Agilent +MICRONICS JAPAN	2,500円/時間
(2F) システム化 技術室	モデリング	88	SPICEモデル抽出ツール	SPICEパラメータ抽出	020000、020101	Silvaco	2,500円/時間
(2F) システム化 技術室	テスト	89	LSIテスター	LSIテスト	DRAGON	HiLevel	2,500円/時間
(2F) 設計技術 室	設計	90	Synopsys社EDAツール群	論理設計・合成系 (Verilog、Design Compilerなど)	6787-0	Synopsys	500円/時間 学内利用(飯塚キャンパス内)のみに限る
		91	Mentor社EDAツール群	レイアウト検証系 (Calibre DRC、LVS) + 寄生値抽出	264860	Mentor	500円/時間 学内利用(飯塚キャンパス内)のみに限る
		92	プロセスデバイスシミュレータ	プロセスシミュレーション、デバイス特性シミュレーション	010101~010224	Silvaco	500円/時間 学内利用(飯塚キャンパス内)のみに限る
(1F) 材料作製 室	描画	93	マスクレス露光装置	g, h, i線露光 5mm角~125mm角試料に対応 dxl, gdsII, cif, gerberデータ対応	MLA100	Heidelberg	4,000円/時間
(1F) 炉体室	膜厚測定	94	エリブソメーター	試料台: 6inch ビーム径: 1mm φ 測定範囲数 Å ~ 6ミクロン (SiO2/Si)	LSE	ガートナ	2,500円/時間
(1F) 材料作製 室	描画	95	マスクレス露光装置	露光 25mm角以下の試料 分解能: 5ミクロン	PALET	ネオアーク	4,000円/時間
(1F) 炉体室	膜厚測定	96	膜厚測定器	透明薄膜の光学的膜厚測定(非接触)	M5000	ナノスペック	2,500円/時間
(1F) 材料作製 室	薬品調合 無機薬品洗浄	97	無機ドラフトチャンバー2	無機薬品、CMPスラリー調合		Dan-Takuma	2,500円/時間
(2F) マイクロ化 技術室	表面観察	98	実体顕微鏡2	表面観察	SMZ1500	ニコン	1,000円/時間
(1F) プロセス 室: CR	成膜	99	スパッタ装置3	各種金属膜の堆積 2inchターゲット φ4inch以下の基板対応	EB-1000	キヤノンアネルバ	4,000円/時間
(1F) フォト室	表面観察	100	3次元光学顕微鏡	表面観察	VHX-7000	Keyence	2,500円/時間
(2F) システム化 技術室	特性評価	101	オートブローパー	MOSTランジスター特性評価	B1500A+HSP-150	Agilent+HISOL	2,500円/時間

(2F) マイクロ化 技術室	表面観察	102	共焦点レーザー顕微鏡	表面の3次元観察(白色干渉計搭載)	VK-X3000	キーエンス	2,500円/時間
(2F) 設計技術 室	設計	103	レイアウト作成ツール	レイアウト作成	L-Edit	Tanner	2,000円/時間
(1F) 炉体室	膜厚測定	104	表面形状測定器3	段差測定	ET200A	小坂研究所	2,500円/時間
(2F) システム化 技術室	ダイボンディ ング	105	エポキシダイ ボンダー	ダイ(チップ)ボンディング	7200CR	ハイソル	2,500円/時間
(1F) 材料作製 室	研磨	106	CMP装置	ポリッシング	RDP-500	不二越機械	4,000円/時間
(1F) 材料作製 室	洗浄	107	ブラシ洗浄装置	2流体洗浄、ブラシ洗浄	DT-PCMP6-M	ダルトン	4,000円/時間
(1F) 材料作製 室	現像	108	有機ドラフトチャンバー3	有機溶剤、フトリソ現像	GF1L-15TNZ	ヤマト科学	2,500円/時間
(1F) 材料作製 室	現像	109	有機ドラフトチャンバー4	有機溶剤、フトリソ現像	GF1L-15TNZ	ヤマト科学	2,500円/時間
(1F) 材料作製 室	ベーク	110	ホットプレート3	フォトレジスト乾燥	TH-900	アズワン	1,000円/時間

- ・使用可能時間は9:00～17:00とする。
- ・1回の利用あたり、30分単位で切り上げて課金
- ・上記時間外での利用が生じた場合には、装置利用料金x1.5倍に加え時間外管理費用(15,000円/時間)を徴収する。

品番	操作指導料・代理操作料・工程管理費用	料金
op	操作指導料	9,000円/時間
ops	代理操作	15,000円/時間
pm	工程管理費(お任せコース(委託試作)実施時)	2,200円/工程・バッチ

品番	個別講習料金	料金
Lec1	個別講習(教授)	24,000円/時間
Lec2	個別講習(准教授)	20,000円/時間
Lec3	個別講習(講師)	16,000円/時間
Lec3	個別講習(助教)	15,000円/時間

品番	CR内デシケータ利用料金	料金
u1a	A	3,200円/月
u1b	B	2,000円/月

品番	白衣更衣室ロッカー利用料金	料金
u2	白衣更衣室ロッカー	1,000円/月

品番	フォトマスク(レチクル)作製・レンタル料金	料金
998	フォトマスク(レチクル)作製	125,200円/枚
rm	テスト露光用フォトマスク(レチクル)レンタル	10,000円/日

品番	消耗品代理購入・薬品保管費	料金
sd	消耗品代理購入	実費 x 1.3 円
bk	薬品保管費	10,000円/本・月

- ※装置利用料金および操作指導料、代理操作料、個別講習料は、1回の利用で30分単位で切り上げし課金。
- ※薬品保管費用は専用で使用される場合に課金致します。

消耗品料金			
品番	品名	使用単位	単価
s1	Siウエハ	1枚	¥3,440
s2	マスクブランクス(ステッパー用5インチ)	1枚	¥17,680
s3	マスクブランクス(アライナー用5インチ)	1枚	¥3,380
s4	マスクブランクス(アライナー用4インチ)	1枚	¥3,250

s5	EBレジスト(ポジ)ZEP-520		1cc	¥3,900
s6	EBレジスト(ネガ)SAL-601		1cc	¥850
s7	マスクケース		1個	¥3,900
s8	蒸着金線		10 mm	¥2,600
s9	FIB-SEM FIB Gaイオン源使用		10分	¥590
s10	FIB-SEMプラチナデポ		10分	¥780
s11	ウエハケース		1組	¥1,970
s12	FIB-SEMカーボンデポ		10分	¥120
s13	蒸着アルミ線		10 mm	¥10
s14	チップトレイ		1セット	¥2,860
s15	クリーンスーツ(M~6L)		1着	¥11,290
s16	クリーンシューズ(23.5cm~29cm)		1足	¥12,150
s17	チップ搬送ケース		1個	¥3,920
s18	再生Siウエハ		1枚	¥1,790
s19	膜厚測定用Siチップ		1チップ	¥7,460
s20	膜厚測定用SiO2付きSiチップ		1チップ	¥11,430
s21	膜厚測定用SiO2付き4インチウエハ		1枚	¥45,710
s22	石英ウエハ(溶融石英)		1枚	¥6,440
s23	SiO2研磨用スラリー		100 g	¥360
s24	Cu研磨用スラリー		100 g	¥970
s25	Ti研磨用スラリー		100 g	¥1,220
s26	CMP部材費		ドレス1回	¥120
Au	スパッターターゲット	Au	10 nm	¥2,220
Pt	スパッターターゲット	Pt	10 nm	¥500
Ag	スパッターターゲット	Ag	10 nm	¥40
Al	スパッターターゲット	Al	10 nm	¥40
AlN	スパッターターゲット	AlN	10 nm	¥70
Al2O3	スパッターターゲット	Al2O3	10 nm	¥90
AlSi_1	スパッターターゲット	AlSi(1%)	10 nm	¥90
AlSi_3	スパッターターゲット	AlSi(3%)	10 nm	¥90
Co	スパッターターゲット	Co	10 nm	¥200
Cr	スパッターターゲット	Cr	10 nm	¥40
Cu	スパッターターゲット	Cu	10 nm	¥30
Ge	スパッターターゲット	Ge	10 nm	¥30
ITO	スパッターターゲット	ITO	10 nm	¥170
Ni	スパッターターゲット	Ni	10 nm	¥60
Si	スパッターターゲット	Si	10 nm	¥30
SiO2	スパッターターゲット	SiO2	10 nm	¥60
Ta	スパッターターゲット	Ta	10 nm	¥50
Ta2O5	スパッターターゲット	Ta2O5	10 nm	¥130
Ti	スパッターターゲット	Ti	10 nm	¥110
TiN	スパッターターゲット	TiN	10 nm	¥90
TiO2	スパッターターゲット	TiO2	10 nm	¥120
W	スパッターターゲット	W	10 nm	¥60
RCA	RCA洗浄槽薬品		1回	¥1,520
SPM	SPM洗浄槽薬品		1回	¥1,900

BHF	BHF洗浄槽薬品	1回	¥1,600
XeF2	XeF2ガス	1回	¥390
TMA	TMAガス	1回	¥60
J1	1.イオン注入装置除害剤	10分 (BF3、PH3)	¥60
J2	2.減圧CVD装置除害剤	10分 (SiH4)	¥320
J3	3.PE-CVD装置除害剤	10分 (SiH4、NH3、CF4)	¥1,080
J15	15.Si系材料ドライエッチング装置除害剤	10分 (CF4、CHF3、F2)	¥90
J16	16.Metal系材料ドライエッチング装置除害剤	10分 (BCl3、Cl2、F2)	¥1,020
J73	73.厚膜CVD除害剤	10分 (TEOS、TMP、TEB、CF4)	¥170
J74	74.ALD装置除害剤	10分 (TMA)	¥150
J75	75.高速深堀RIE除害剤	10分 (SF6、C4F8、CHF3)	¥550

※ 除害剤料金は指定のガスを利用した時のみ課金する

※ 1回の利用あたり、使用単位で切り上げて課金

※その他の消耗品費は、別途請求する